

## 附件四、技術說明表



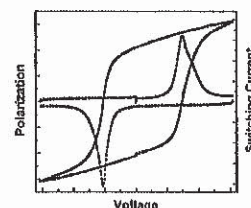
### 一種製造高品質鐵電薄膜的技術

提案人：陳敏璋 教授

單位：國立臺灣大學 材料系

簡歷：<https://atomicengineering1.wixsite.com/website>

請放任一代表照片或圖片



市場及需求：半導體產業之電晶體以及記憶體等相關元

件

技術摘要(含成果)：利用一種製造高品質鐵電薄膜的技術，在特定製程中調控出適配比例，達成優良鐵電性表現之薄膜。

優勢：優良鐵電特性

競爭產品：鉛摻雜氧化鉛鐵電薄膜

專利現況：

聯絡方式(請不用填)：

臺大產學合作總中心

Tel: 02-3366-9945, E-mail: [ordiac@ntu.edu.tw](mailto:ordiac@ntu.edu.tw)



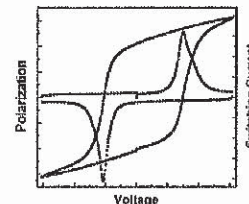
## A deposition method for high quality ferroelectric thin films

**PI:** Prof. Chen, Miin-Jang  
 Department of Materials Science and Engineering,  
 National Taiwan University

**Experience:** <https://atomicengineering1.wixsite.com/website>

**Market Needs:** Transistors and memory devices in the semiconductor industry

An interesting **photo** related to your technology



**Our Technology:** A specific optimal deposition process was utilized to produce high-quality ferroelectric thin films with significant ferroelectric properties.

**Strength:** Significant ferroelectricity

**Competing Products:** Zr-doped HfO<sub>2</sub> thin films

**Intellectual Properties:**

**Contact (do not need to fill out):**

Center for Industry-Academia Collaboration, NTU  
 Tel: 02-3366-9945, E-mail: [ordiac@ntu.edu.tw](mailto:ordiac@ntu.edu.tw)